#### УДК 544.62; 539.23; 538.93; 537.322

#### Ольховская С.И., Рогачева Е.И.



Ольховская С.И.

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», ул. Фрунзе, 21, Харьков, 61002, Украина

# РАЗМЕРНЫЕ ЭФФЕКТЫ В ТОНКИХ ПЛЕНКАХ ТЕЛЛУРИДА СВИНЦА И ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА



Рогачева Е.И.

Проведено исследование влияния толщины d на термоэлектрические свойства (коэффициент Зеебека S, электропроводность  $\sigma$ , коэффициент Холла  $R_H$  и подвижность носителей заряда  $\mu_H$ ) пленок толщиной d = 8 - 170 нм, полученных термическим испарением в вакууме кристаллов PbTe c избытком свинца на подложки (001) KCl и покрытых слоем  $Al_2O_3$ . Установлено, что пленки с толщинами d < 75 нм обладают дырочной проводимостью, а при d > 75 нм перенос заряда определяется носителями заряда *n*-типа. Инверсия знака проводимости вблизи  $d \approx 75$  нм связывается с изменением условий термодинамического равновесия в пленках по сравнению с кристаллом, а также с особенностями испарения и конденсации материала. На d-зависимостях кинетических коэффициентов пленок с дырочной проводимостью наблюдаются осцилляции, наличие которых объясняется квантованием дырочного газа носителей. Расчет периода осцилляций  $\Delta d$  с использованием модели бесконечно глубокой прямоугольной потенциальной ямы хорошо согласуется с экспериментально определенным значением  $\Delta d$ . Для пленок с *n*-типом проводимости значения кинетических коэффициентов увеличиваются с ростом d, что указывает на проявление классического размерного эффекта.

Ключевые слова: тонкая пленка, классический и квантовый размерный эффект, толщина.

The influence of thickness d on thermoelectric properties (the Seebeck coefficient S, electric conductivity  $\sigma$ , the Hall coefficient  $R_{H}$ , charge carrier mobility  $\mu_{H}$ ) of films d = 8 - 170 nm in thickness, prepared by vacuum evaporation of PbTe crystals with lead excess onto (001) KCl substrates coated with  $Al_2O_3$  layer has been studied. It has been established that films with d < 75 nm possess hole conductivity, and at d > 75 nm carrier transport is determined by n-type charge carriers. The inversion of conductivity sign close to  $d \approx 75$  nm is attributed to a change in thermodynamic equilibrium conditions in the films as compared to crystal, as well as to material evaporation and condensation features. Oscillations on the d-dependences of the kinetic coefficients of films with p-type conductivity are attributable to quantization of the hole gas of carriers. Calculation of oscillation period  $\Delta d$  using a model of infinitely deep rectangular potential well is in good agreement with the experimentally determined  $\Delta d$  value. For n-type conductivity films the values of kinetic coefficients increase with increase in d, which points to manifestation of a classical size effect.

Key words: thin film, classical and quantum size effect, thickness.

#### Введение

Полупроводниковые соединения IV-VI элементов периодической системы широко применяются в термоэлектричестве, оптоэлектронике, ИК-технике и других областях науки и

техники [1-4]. Теллурид свинца (*PbTe*) хорошо известен как один из лучших материалов для термоэлектрических (ТЭ) генераторов, работающих в интервале средних температур [2, 3].

Обнаружение значительного увеличения ТЭ добротности в сверхрешетках на основе полупроводников класса IV-VI [5-8], предсказанное ранее теоретически [5], вызывает интерес к изучению ТЭ свойств *PbTe* в тонкопленочном состоянии.

К одной из основных задач нанофизики и нанотехнологий можно отнести разработку методов получения и исследования свойств материалов в низкоразмерном состоянии (квантовые ямы, квантовые нити, квантовые точки). В тонкопленочном состоянии размер образца в одном направлении значительно меньше размеров образца в двух других направлениях. Значительное влияние на транспортные свойства 2*D*-структур могут оказывать размерные эффекты: классический (КлРЭ), который можно наблюдать в случае, когда длина свободного пробега носителей заряда соизмерима с толщиной *d* пленки, и квантовый (КРЭ), проявляющийся, когда толщина пленки становится сравнимой с величиной длины волны де Бройля [9].

В ряде работ (см., например, [10-16]) для пленок халькогенидов свинца (*PbS*, *PbSe*, *PbTe*), полученных термическим испарением в вакууме шихты с различной концентрацией носителей заряда как *n*-, так и *p*-типа (от ~  $10^{18}$  до  $10^{20}$  см<sup>-3</sup>), авторы наблюдали осциллирующий характер зависимостей ТЭ свойств (коэффициента Зеебека *S*, электропроводности  $\sigma$ , Холловской подвижности носителей заряда  $\mu_H$  и ТЭ мощности  $P = S^2 \sigma$ ) от толщины *d* пленок, связывая это явление с проявлением КРЭ. Обнаруженный в пленках *PbSe*, полученных из кристаллов стехиометриического *p*-*PbSe*, рост с толщиной монотонных составляющих  $\sigma$  и  $\mu_H$ , авторы работы [17] объяснили проявлением КлРЭ, обусловленного увеличением вклада диффузного рассеяния носителей на интерфейсах при уменьшении *d*. Результаты, полученные в работах [16, 17], продемонстрировали, что, изменяя толщину пленок с малым шагом по величине *d* в широком интервале толщин, можно на одних и тех же объектах одновременно изучать КРЭ и КлРЭ.

Цель настоящей работы – исследовать размерные эффекты в пленках, полученных термическим испарением в вакууме на подложки (001) *KCl* кристаллов *n-PbTe* с избытком свинца (2 ат.% *Pb*) и покрытых слоем  $Al_2O_3$ . В работе [15] на пленках, полученных аналогичным образом, защищенных от взаимодействия с кислородом воздуха слоем *EuS* толщиной ~ 30 нм и имеющих *n*-тип проводимости, были выявлены толщинные осцилляции кинетических свойств с периодом  $\Delta d \sim 100$  нм, хотя теоретический расчет  $\Delta d$ , с использованием модели прямоугольной ямы с бесконечно высокими стенками, давал существенно меньшее значение:  $\Delta d = 20$  нм. Наблюдаемое несоответствие авторы [15] связали со значительным количеством упрощений, используемых в модели, а также с недостаточным количеством тонкопленочных образцов с различными значениями *d*. Последнее обстоятельство определило постановку настоящей работы.

В результате проведенных в работе исследований удалось выявить наличие в интервале малых толщин области с *p*-типом проводимости, обнаружить осциллирующий характер *d*-зависимостей кинетических свойств в этой области, определить период осцилляций, практически соответствующий теоретически рассчитанному, а также наблюдать проявление КлРЭ в области толщин с электронным типом проводимости.

## Методика эксперимента

Эпитаксиальные пленки *PbTe* с толщинами d = 8 - 170 нм были получены термическим испарением в вакууме (~  $10^{-5} - 10^{-6}$  Па) кристаллов *PbTe*<*Pb*> с избытком свинца (2 ат.% *Pb*) с

последующей конденсацией на свежие сколы (001) *КСl* при температуре (520 ± 10) К. Скорость конденсации материала составляла 0.5 - 1.0 нм/с. Толщину пленки *d* контролировали с помощью кварцевого резонатора, предварительно откалиброванного при помощи интерферометра (для d > 100 нм) и метода малоугловой рентгеновской дифракции (для d < 100 нм). Сверху на пленку электронно-лучевым методом наносили слой  $Al_2O_3$  толщиной ~ 10 - 15 нм. Широкозонный полупроводник  $Al_2O_3$ , с одной стороны, предохранял пленки PbTe<Pb> от окисления и механических повреждений, а, с другой стороны, выступал в качестве барьерного слоя, вклад которого в проводимость мал. Электропроводность  $\sigma$  и коэффициент Холла  $R_H$  измеряли стандартным *dc* методом с погрешностью, не превышающей ± 5 %. В качестве контактов использовали индий. Холловскую подвижность носителей заряда  $\mu_H$  рассчитывали по формуле  $\mu_H = R_H \sigma$ , а концентрацию носителей заряда определяли в предположении одного сорта носителей заряда как  $n = r/(e \cdot R_H)$ , где холл-фактор r = 1. Измерения *S* проводили компенсационным методом относительно меди в плоскости пленок с точностью ± 3 %. Тип носителей заряда определяли по знаку  $R_H$  и *S*. Измерения проводили на свежеприготовленных образцах при комнатной температуре.

#### Результаты

Измерения показали, что кристалл *PbTe*<*Pb*>, используемый в качестве шихты для получения пленок, обладал электронной проводимостью (что согласуется с известными литературными данными [1]) и имел следующие электрофизические параметры:  $n = 7 \cdot 10^{18}$  см<sup>-3</sup>, S = -180 мкВ/К,  $\sigma = 140$  Ом<sup>-1</sup>·см<sup>-1</sup>,  $\mu_H = 125$  см<sup>2</sup>/В·с. При переходе к тонкопленочному состоянию электронный тип проводимости наблюдался только в пленках с толщиной  $d \ge 75$  нм, а при меньших толщинах знак проводимости изменялся на противоположный.

Одной из возможных причин появления дырочной проводимости при  $d \le 75$  нм в пленках *PbTe*<*Pb*> может быть изменение условий термодинамического равновесия в тонкопленочном состоянии по сравнению с объемным кристаллом и, как следствие, - изменение равновесной концентрации дефектов в пленке. Можно также предположить, что смена типа проводимости с изменением толщины пленки определяется особенностями испарения кристаллов. В процессе нагрева *PbTe* испаряется в основном в виде молекул *PbTe* (энергия диссоциации молекулы PbTe 229.2 Дж/моль значительно превышает теплоту сублимации 224.6 Дж/моль), хотя помимо молекул *PbTe* в парах в незначительном количестве могут присутствовать атомы свинца или теллура [18]. Хотя содержание свободного *Те* в парах мало, при конденсации этот избыточный Те может аккумулироваться в объеме осаждаемой пленки и приводить к р-типу проводимости. Влияние данного фактора будет наиболее значительным при малых толщинах пленки. Следует также учитывать возможность частичного реиспарения избыточного свинца в процессе осаждения на подложки. Тот факт, что в работе [15] при использовании в качестве шихты того же материала, что и в настоящей работе, р-область не наблюдалась, по-видимому, можно объяснить тем, что толщина (30 нм) и материал (EuS) защитного покрытия на пленке PbTe отличались от значений этих величин в настоящей работе и лучше предохраняли пленку от окисления. В работах [15, 19] было установлено, что типом проводимости можно управлять путем изменения толщины d пленки и толщины защитного слоя  $d_{EuS}$ : наличие EuS с  $d_{EuS} > 30$  нм полностью защищает пленки халькогенидов свинца от окисления и сохраняет *n*-тип проводимости, а при *d<sub>EuS</sub>* < 30 нм точка инверсии типа проводимости смещается в область меньших толщин.

На рис. 1 приведены *d*-зависимости *S*,  $\sigma$ ,  $R_H$  и  $\mu_H$  тонких пленок *PbTe*<*Pb*>, полученные в настоящей работе.

Из рис. 1 видно, что в интервале толщин, соответствующих *p*-типу проводимости в пленках *PbTe*<*Pb*>, наблюдается немонотонный характер изменения *S*,  $\sigma$ , *R<sub>H</sub>* и  $\mu_H$  с толщиной: кинетические коэффициенты осциллируют с ростом *d*. Отметим, что положения максимумов на зависимостях *S*(*d*) и *R<sub>H</sub>*(*d*) совпадают между собой и соответствуют минимумам на кривых  $\sigma(d)$  и  $\mu_H(d)$  (рис. 1). Этот факт, а также то обстоятельство, что  $\sigma$ , *S* и *R<sub>H</sub>* измерялись независимо друг от друга, подтверждает реальность существования осцилляций. Среднее расстояние между максимумами или минимумами (период осцилляций) составляет  $\Delta d = (16 \pm 2)$  нм. Следует отметить, что амплитуды осцилляций на зависимостях *S*(*d*),  $\sigma(d)$ , *R<sub>H</sub>*(*d*) и  $\mu_H(d)$  достаточно велики, достигая 25 %, 100 %, 80 % и 80 %, соответственно. С ростом толщины пленки амплитуда *d*-осцилляций кинетических коэффициентов уменьшается.



Рис. 1. Размерные зависимости коэффициента Зеебека S (а), электропроводности σ (б), коэффициента Холла R<sub>H</sub> (в) и холловской подвижности μ<sub>H</sub> (г): 1 – кристалл PbTe<Pb>; 2 – пленки (001)KCl/PbTe<Pb>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.

Наличие осцилляций на *d*-зависимостях кинетических свойств пленок *p-PbTe*<*Pb*> мы связываем с проявлением КРЭ. Учитывая, что пленка *PbTe*<*Pb*> расположена между двумя изоляторами – подложкой (001) *KCl* и защитным слоем *Al*<sub>2</sub>*O*<sub>3</sub>, движение носителей заряда (в данном случае, дырок) в направлении, перпендикулярном плоскости тонкой пленки, ограничено, что приводит к квантованию поперечной составляющей квазиимпульса дырок в данном

направлении и образованию поперечных энергетических подзон. Движение носителя в плоскости пленки не квантуется. Поэтому структуру (001) *KCl/PbTe*<*Pb*>/*Al*<sub>2</sub>*O*<sub>3</sub> приближенно можно представить как прямоугольную потенциальную квантовую яму с бесконечно высокими стенками. В таком случае в приближении эффективной массы уровни энергии записываются как [9]:

$$E = \frac{\hbar^2}{2m_z^*} \frac{\pi^2}{d^2} N^2 + \frac{\hbar^2 k_x^2}{2m_x^*} + \frac{\hbar^2 k_y^2}{2m_y^*}, \qquad (1)$$

где  $m_z^*$  – эффективная масса вдоль направления, перпендикулярного квантовой яме;  $k_x$ ,  $k_y$  и  $m_x^*$ ,  $m_y^*$  – компоненты волнового вектора и эффективной массы, соответственно, при движении носителя заряда параллельно квантовой яме. При изменении d на величину, равную половине длины волны де Бройля,  $\lambda_F/2$  ( $\lambda_F$  – длина волны де Бройля на уровне Ферми), подзоны N будут последовательно пересекать уровень Ферми  $\varepsilon_F$ , что повлечет за собой скачкообразное изменение плотности состояний. Осцилляции плотности состояний приводят к осцилляциям транспортных свойств. Величины периода осцилляций  $\Delta d$  и N могут быть определены, используя следующие выражения [9]:

$$\Delta d = \frac{\lambda_F}{2} = \frac{h}{\sqrt{8m_z^*\varepsilon_F}},\tag{2}$$

$$N = \frac{k_F d}{\pi} = \frac{d}{\lambda_F / 2} = \frac{d\sqrt{8m_z^* \varepsilon_F}}{h}.$$
(3)

Нетрудно показать [14], что толщина  $d_1$ , при которой первая подзона пересекает уровень Ферми ( $E_1 = \varepsilon_F$ ), равна  $d_1 = h/\sqrt{8m_z^*\varepsilon_F} = \Delta d$ , т.е. не что иное, как период осцилляций. Поэтому для определения  $\Delta d$  нет необходимости проводить измерения транспортных свойств пленок в широком интервале толщин, а достаточно экспериментально выявить первый экстремум на *d*-зависимостях свойств, который и даст наиболее точное значение величины  $\Delta d$ .

Для исследуемых структур (001) *KCl/PbTe*<*Pb*>/*Al*<sub>2</sub>*O*<sub>3</sub> с учетом известных значений эффективной массы дырок в *p*-*PbTe* (поперечная и продольная компоненты эффективной массы  $m_t^* = 0.022 m_0$ ,  $m_l^* = 0.31 m_0$ , соответственно) [1] и значения  $\varepsilon_F$ , определенного по средней концентрации дырок ( $p = 3.8 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$ ) на участке с *p*-типом проводимости (d < 75 нм), по формуле (2) был рассчитан период осцилляций, который составил  $\Delta d = (17 \pm 2)$  нм. Полученное значение  $\Delta d$  очень хорошо согласуется с экспериментально определенным средним расстоянием между соседними максимумами на *d*-зависимостях *S*,  $R_{H_c}$   $\sigma$  и  $\mu_H$ , также, как и с положением первого экстремума в *p*-области ( $d_l = 14 \pm 1 \text{ нм}$ ) (рис. 1).

Квантовые толщинные осцилляции кинетических свойств отчетливо выявляются при комнатной температуре, хотя согласно теоретическим представлением, заметное проявление осцилляций возможно только при низких температурах [20]. Факт наблюдения КРЭ может указывать на достаточно высокую степень структурного совершенства пленок и/или на влияние других факторов.

В пленках *n-PbTe*<*Pb*> (с d > 75 нм) получены большие значения  $\sigma$  и  $\mu_H$ , чем в кристалле *PbTe*<*Pb*>, из которого препарировались пленки, что может свидетельствовать о более высоком структурном совершенстве пленок по сравнению с кристаллом.

При анализе характера изменения кинетических коэффициентов от толщины пленок с *n*-типом проводимости (d > 75 нм) видно (рис. 1), что с ростом d монотонные составляющие S, σ и  $µ_H$  увеличиваются и постепенно выходят на насыщение. Такой характер изменения *S*, σ и  $µ_H$  с толщиной указывает на существование КлРЭ.

## Выводы

Методом термического испарения в вакууме кристаллов PbTe с избытком свинца с последующей конденсацией на подложки (001) *KCl* получены тонкие пленки PbTe < Pb > толщиной d = 8 - 170 нм. Установлено, что имеет место смена типа проводимости с *n*- на *p*-тип при толщине слоя PbTe  $d \approx 75$  нм. Предполагается, что инверсия знака проводимости может быть связана с изменением условий термодинамического равновесия в 2*D*-состоянии по сравнению с объемным кристаллом, особенностями процессов испарения и конденсации либо с недостаточной толщиной защитного покрытия  $Al_2O_3$ .

Показано, что в интервале толщин  $d \le 75$  нм наблюдаются толщинные осцилляции коэффициента Зеебека, коэффициента Холла, электропроводности и подвижности дырок с периодом  $\Delta d = (16 \pm 2)$  нм, что связывается с квантованием энергетического спектра дырок и проявлением КРЭ. Теоретический расчет периода квантовых осцилляций с использованием модели бесконечно глубокой прямоугольной потенциальной ямы хорошо согласуется с экспериментально определенным значением  $\Delta d$ .

Анализ монотонных составляющих зависимостей транспортных коэффициентов от толщины пленок с электронной проводимостью ( $d \ge 75$  нм) показал, что значения коэффициента Зеебека, электропроводности и подвижности электронов увеличиваются с ростом толщины и постепенно выходят на насыщение, что связывается с проявлением классического размерного эффекта.

Работа выполнена при поддержке Государственного Фонда Фундаментальных исследований Украины (Грант № UU 42/006) и Фонда гражданских исследований и развития США (CRDF Global, грант № UKP-7074-KK-12).

## Литература

- 1. Равич Ю.И. Методы исследования полупроводников в применении к халькогенидам свинца *PbTe*, *PbSe* и *PbS*. / Ю.И. Равич, Б.А. Ефимова, И.А. Смирнов М.: Наука, 1968. 384 с.
- 2. C. Sorrell, S. Sugihara, and J. Nowotny, *Materials for Energy Conversion Devices* (Woodhead Pub. Limited, 2005), 416 p.
- 3. A.D. LaLonde, Y. Pei, H. Wang, and G.J. Snyder, Lead Telluride Alloy Thermoelectrics, *Materials Today* 14, 526 532 (2011).
- 4. Y. Pei, H. Wang, and G.J. Snyder, Band Engineering of Thermoelectric Materials, *Advanced Materials* 24, 6125 6135 (2012).
- M.S. Dresselhaus, Y.-M. Lin, S.B. Cronin, O. Rabin, M.R. Black, and G. Dresselhaus, Semiconductors and Semimetals: Recent Trends in Thermoelectric Materials Research (San Diego, CA: Academic Press, 2001), 121 p.
- L.D. Hicks, T.C. Harman, X. Sun, and M.S. Dresselhaus, Experimental Study of the Effect of Quantum-Well Structures on the Thermoelectric Figure of Merit, *Phys. Rev. B* 53, R10493 – R10496 (1996).
- 7. T.C. Harman, D.L. Spears, and M.J.J. Manfra, High Thermoelectric Figures of Merit in *PbTe* Quantum Wells, *J. Electron. Mater.* 25, 1121 1127 (1996).
- 8. T.C. Harman, D.L. Spears, and M.P. Walsh, PbTe/Te Superlattice Structures with Enhanced

Thermoelectric Figures of Merit, J. Electron. Mater. 28, L1 – L5 (1999).

- 9. Комник Ю.Ф. Физика металлических пленок. / Ю.Ф. Комник Москва: Атомиздат, 1979. 264 с.
- E.I. Rogacheva, T.V. Tavrina, O.N. Nashchekina, S.N. Grigorov, K.A. Nasedkin, M.S. Dresselhaus, and S.B. Cronin, Quantum Size Effects in *PbSe* Quantum Wells, *Appl. Phys. Lett.* 80, 2690 – 2693 (2002).
- 11. E.I. Rogacheva, O.N. Nashchekina, T.V. Tavrina, M. Us, M.S. Dresselhaus, S.B. Cronin, and O.Rabin, Quantum Size Effects in IV-VI Quantum Wells, *Physica E* 17, 313-315 (2003).
- E.I. Rogacheva, O.N. Nashchekina, Y.O. Vekhov, M.S. Dresselhaus, and S.B. Cronin, Effect of Thickness on the Thermoelectric Properties of *PbS* Thin Films, *Thin Solid Films* 423, 115 – 118 (2002).
- E.I. Rogacheva, O.S. Vodorez, O.N. Nashchekina, A.Yu. Sipatov, A.G. Fedorov, S.I. Olkhovskaya, and M.S. Dresselhaus, Oscillatory Behavior of Thermoelectric Properties in *p-PbTe* Quantum Wells, *J. Electronic Materials* 39 (9), 2085 – 2091 (2010).
- 14. E.I. Rogacheva and M.S. Dresselhaus, Quantum Size Effects and Thermoelectric Transport in IV-VI-Based 2D-Structures, *Proc. ECT (Odessa, Ukraine, 2007)*, P. 29 – 34.
- E.I. Rogacheva, O.N. Nashchekina, S.N. Grigorov, M.A. Us, M.S. Dresselhaus, and S.B. Cronin, Oscillatory Behaviour of the Transport Properties in *PbTe* Quantum Wells, *Nanotechnology* 14, 53 – 59 (2003).
- 16. Рогачева Е.И. Размерные эффекты в тонких пленках *PbSe* / Е.И. Рогачева, О.Н. Нащекина, С.И. Ольховская, М.С. Дресселхаус // Термоэлектричество. 2012. № 4.– С. 27 35.
- 17. Рогачева Е.И. Размерный эффект в тонких пленках селенида свинца / Е.И. Рогачева, С.И. Ольховская, А.Ю. Сипатов, А.Г. Федоров // Вісник ХНУ, серія «Фізика». 914 (13). 2010. С. 115 118.
- 18. Фреик Д.М. Получение пленок соединений *А*<sup>IV</sup>*B*<sup>VI</sup> (обзор) / Д.М. Фреик // Приборы и техника эксперимента. 1976. № 5. С. 7 17.
- E.I. Rogacheva, I.M. Krivulkin, O.N. Nashchekina, A.Yu. Sipatov, V.V. Volobuev, M.S. Dresselhaus, Effect of Oxidation on the Thermoelectric Properties of *PbTe* and *PbS* Epitaxial Films, *Applied Physics Letters* 78, 1661 – 1663 (2001).
- 20. Тавгер Б.А. Квантовые размерные эффекты в полупроводниковых и полуметаллических пленках / Б.А. Тавгер, В.Я. Демиховский // УФН. 1968. Т. 96. С. 61 86.

Поступила в редакцию 20.09.2013.